



بیست و ششمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک ایران و دوازدهمین کنفرانس
مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه خوارزمی،
تهران، ایران.
۱۶-۱۵ بهمن ۱۳۹۸



طراحی و ساخت نانو پوشش اپتیکی چند لایه‌ای به عنوان انتخابگر طیفی در پنل‌های فتوولتائیک سیلیکونی

کامبیز دهقانی^۱، مجتبی رحیمی^۲ و سید محمد باقر مرعشی^۳

۱-دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان ، k.dehghani@stu.vru.ac.ir

۲-دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، m_rahimi@vru.ac.ir

۳-دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، smb_marashi@vru.ac.ir

چکیده - در این مقاله، نانو پوشش چند لایه‌ای $\text{TiO}_2/\text{Ag}/\text{TiO}_2$ به عنوان انتخابگر طیفی در پنل‌های خورشیدی بر روی بستر شیشه ای با استفاده از روش لایه نشانی لیزری تحت خلاء ساخته شده است. ضخامت‌های متفاوتی برای هر یک از لایه‌ها انتخاب گردید و این ضخامت‌ها بهینه شدند تا حداکثر بازتاب را در محدوده مادون قرمز و همچنین حداکثر عبور را هم در محدوده مرئی طیف خورشید داشته باشند. حالت بهینه نانو پوشش $\text{TiO}_2/\text{Ag}/\text{TiO}_2$ با ضخامت $48/18/48$ نانومتر بدست آمده که دارای انتقال حداکثر 88% در طول موج متوسط 580 نانومتر و بازتاب بالای 90% در طول موج متوسط 900 نانومتر دارد.

کلید واژه- فیلتر اپتیکی، انتخابگر طیفی، پنل خورشیدی، $\text{TiO}_2/\text{Ag}/\text{TiO}_2$.

Design and fabrication of multilayer optical nano coating as spectral selector in silicon solar photovoltaic panels

Kambiz Dehghani¹, Mojtaba Rahimi² and Seyed Mohammad Bagher Marashi³

1-Vali-e-Asr University of Rafsanjan, k.dehghani@stu.vru.ac.ir

2-Vali-e-Asr University of Rafsanjan, m_rahimi@vru.ac.ir

3-Vali-e-Asr University of Rafsanjan, smb_marashi@vru.ac.ir

Abstract- In this paper, $\text{TiO}_2/\text{Ag}/\text{TiO}_2$ multilayer optical nano coating as spectral selector in silicon solar photovoltaic panels on a glass substrate using the PLD method. Different Thickness choose for each of layer and Thickness are optimized for maximum reflection in the NIR-IR region and maximum transmission in the visible region of sin light. $\text{TiO}_2/\text{Ag}/\text{TiO}_2$ optimized coating which has a transmission capability of 88% in Wavelength 580 nm in the visible region and a reflection of 90% in Wavelength 900 nm in the NIR-IR region.

Keywords: optical filter, spectral selector, solar panel, $\text{TiO}_2/\text{Ag}/\text{TiO}_2$.

مقدمه

کارایی پنل خورشیدی فوتوولتائیک سیلیکونی برای نور ورودی بین ۷۰۰ الی ۱۱۰۰ نانومتر، بیش از ۵۰ درصد می‌باشد، اما در طول موج کوتاه یا بزرگتر از این محدوده کم یا صفر است [۱]. نور جذب شده با طول موج بزرگتر از ۱۱۰۰ نانومتر در پنل خورشیدی فوتوولتائیک سیلیکونی به گرما تبدیل می‌شود. در عمل دمای سطح پنل‌های خورشیدی فوتوولتائیک بسته به شرایط محیطی در ماه‌های مختلف سال در حدود ۴۰ الی ۵۰ درجه سانتی‌گراد می‌باشد که این دما در تابستان در مناطق کویری به حدود ۷۵ درجه سانتی‌گراد می‌رسد [۲]. برای جلوگیری از جذب طیف مادون قرمز نور خورشید توسط پنل خورشیدی که یکی از دلایل افزایش دمای پنل است می‌توان از نانو پوشش‌های اپتیکی لایه نازک به عنوان انتخابگر طیفی استفاده نمود.

طراحی نانو پوشش اپتیکی سه لایه‌ای TiO₂/Ag/TiO₂

استفاده از نانو پوشش سه یا چند لایه، ناحیه وسیع‌تری بازتابندگی کمتری را ممکن می‌سازد که در آن پاسخ لایه صاف‌تر است. نانو پوشش‌های سه لایه‌ای دی‌الکتریک/فلز/دی‌الکتریک (D/M/D) مورد استفاده به عنوان انتخابگر طیفی در پنل‌های فوتوولتائیک خورشیدی باید در ناحیه مرئی طیف نور خورشید دارای T=1 و R=0 و در ناحیه مادون قرمز نیز دارای T=0 و R=1 باشند. لایه‌های نانو پوشش اپتیکی سه لایه‌ای به ترتیب هوا/دی‌الکتریک/فلز/دی‌الکتریک/شیشه از بالا به پایین بر روی زیر لایه شیشه قرار داده شدند. عملکرد نانو پوشش D/M/D به طور چشمگیری به ثابت‌های اپتیکی و ضخامت لایه‌ها بستگی دارد. لایه‌های اکسیدی به شدت به استوکیومتری، ناخالصی و نقص موجود در هر لایه بستگی دارند. لایه‌های فلزی به پدیده‌های هسته‌زایی و همبستگی بسیار وابسته هستند. فلز مورد استفاده در این پوشش در ناحیه مادون

قرمز بسیار بازتابنده است. برای لایه فلزی از موادی همچون Cu, Au, Ag و ... استفاده می‌گردد [۳]. مس در مقایسه با نقره ارزانه‌تر است ولی عملکرد آن به شدت تحت تاثیر اکسیداسیون قرار می‌گیرد و رنگ قهوه‌ای آن هم مانعی برای عبور طیف مرئی نور خورشید می‌باشد. ولی نقره در مقایسه با طلا قیمت کمتری دارد پس نقره نامزد مناسبی برای این هدف می‌باشد. لایه‌های دی‌الکتریک در ناحیه طیفی ۴۰۰ تا ۲۰۰۰ نانومتر جذب ندارند. انتقال بالای نور در ناحیه مرئی، ضریب شکست بالا و شکاف باند گسترده، TiO₂ را برای پوشش‌های جاذب UV و کاربردهای لایه نشانی انعکاس حرارتی مناسب کرده است [۴]. انتخاب سه لایه‌ای D/M/D با داده‌های پذیرفته شده برای Ag و TiO₂ تایید شده است [۵ و ۶]. معادله (۱) رابطه ماتریس تبدیل نام دارد. که عناصر ماتریس موارد فوق هستند $m_{11} = \cos \delta$ که $m_{22} = \cos \delta$ و $m_{21} = i n_1 \sqrt{\epsilon_o \mu_o} \sin \delta$ ، $m_{12} = \frac{i \sin \delta}{n_1 \sqrt{\epsilon_o \mu_o}}$ اختلاف فاز نام دارد.

$$M = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix} \quad (1)$$

همچنین در معادلات (۲) و (۳) روابط ضرایب عبور و بازتاب آمده است که با استفاده از آنها خواص بازتابی و عبوری تک لایه یا چند لایه را بررسی می‌کنیم.

$$t = \frac{2\gamma_0}{\gamma_0 m_{11} + \gamma_0 \gamma_s m_{12} + m_{21} + \gamma_s m_{22}} \quad (2)$$

$$r = \frac{\gamma_0 m_{11} + \gamma_0 \gamma_s m_{12} - m_{21} - \gamma_s m_{22}}{\gamma_0 m_{11} + \gamma_0 \gamma_s m_{12} + m_{21} + \gamma_s m_{22}} \quad (3)$$

با توجه به پژوهش‌های انجام شده [۳-۶] و معادلات (۱)، (۲) و (۳) برای لایه دی‌الکتریک ضخامت‌های ۸، ۱۵، ۲۰، ۳۰، ۴۵، ۴۸ نانومتر و برای لایه فلزی ضخامت‌های ۳، ۶، ۹، ۱۲، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۴ نانومتر مورد استفاده و قرار گرفت.

ساخت نانو پوشش اپتیکی $\text{TiO}_2/\text{Ag}/\text{TiO}_2$

نانو پوشش اپتیکی سه لایه‌ای $\text{TiO}_2/\text{Ag}/\text{TiO}_2$ با استفاده از روش لایه نشانی با استفاده از لیزر پالسی در دمای اتاق بر روی زیر لایه‌هایی از جنس شیشه انجام شد که در شکل ۱ تصویر دستگاه PLD آمده است. کلیه زیر لایه‌ها ابتدا بوسیله اسکاج و مایع ظرف‌شویی شستشو داده شدند سپس به مدت ۱۰ دقیقه درون حمام التراسونیک به همراه استون و بعد درون حمام التراسونیک به همراه اتانول و در نهایت درون حمام التراسونیک با پروپانول به مدت ۱۰ دقیقه شستشو داده شدند و بعد با آب فوق خالص شستشو داده شدند و با جریان مستقیم گاز نیتروژن خشک گردیدند.



شکل ۱: تصویر دستگاه لایه نشانی PLD.

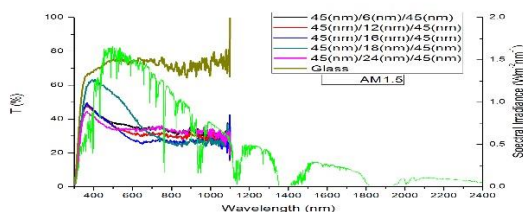
قبل از لایه نشانی فشار محفظه با استفاده از پمپ‌های خلاء توربو و چرخشی تا حد میلی بار کاهش داده شد. برای لایه نشانی دولایه TiO_2 از قرص TiO_2 با قطر ۳۲ میلی‌متر و ضخامت ۳ میلی‌متر با خلوص ۹۹٫۹۹٪ و برای لایه فلز نقره از ورق نقره به قطر ۳۲ میلی‌متر و ضخامت ۰٫۳ میلی‌متر با خلوص ۹۹٫۹۹٪ استفاده شد.

ابتدا اولین لایه TiO_2 به عنوان بر روی زیر لایه نشانی می‌گردد. سپس بدون شکستن خلاء محفظه، لایه Ag به عنوان لایه فلزی بر روی لایه اول لایه نشانی گردید. در آخر لایه TiO_2 بر روی لایه نقره میانی لایه نشانی گردید تا در نهایت نانو پوشش سه لایه‌ای $\text{D}/\text{M}/\text{D}$ بر روی زیر لایه شیشه ساخته شود.

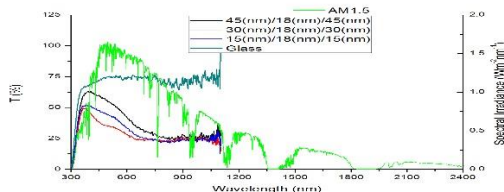
ضخامت لایه‌ها در حین لایه نشانی توسط سنسور ضخامت سنجی با استفاده از کریستال طلا به صورت لحظه‌ای اندازه‌گیری شد. برای لایه‌های مورد استفاده ضخامت‌های متفاوتی ایجاد گردید و میزان جذب، عبور و بازتاب کلیه پوشش‌ها مورد بررسی قرار گرفت و ضخامت‌ها به منظور داشتن بالاترین میزان بازتاب در ناحیه مادون قرمز و بالاترین میزان عبور در ناحیه مرئی طیف نور خورشید بهینه شدند.

نتایج تجربی

برای اندازه‌گیری خواص اپتیکی ساختار سه لایه‌ای از روش طیف سنج مادون قرمز-مرئی-فرابنفش با استفاده از دستگاه اسپکترومتر Lambda 950 در ناحیه ۲۰۰ الی ۲۵۰۰ نانومتر و دستگاه PL در محدوده ۲۰۰ الی ۱۱۰۰ نانومتر استفاده شده است. با توجه به شکل‌های ۲ و ۳ بهترین ضخامت برای لایه دی‌الکتریک حدود ۴۵ الی ۴۸ نانومتر و برای لایه فلزی حدود ۱۶ الی ۲۰ نانومتر است.



شکل ۲: نمودار عبور برای ضخامت‌های مختلف لایه Ag



شکل ۳: نمودار عبور برای ضخامت‌های مختلف لایه TiO_2

در شکل ۴ و ۵ نمودار عبور و بازتاب برای $\text{TiO}_2/\text{Ag}/\text{TiO}_2$ با ضخامت‌های مختلف آمده که مبین بازتاب بیش از ۹۰٪ در محدوده ۱۱۰۰ الی ۲۰۰۰ نانومتر و عبور بالا در محدوده

این مقاله در صورتی، دارای اعتبار است که در سایت www.opsi.ir قابل دسترسی باشد.